## 能動デバイスによる乱流抵抗低減 - ピエゾアレーによるストリーク構造の制御

機械研 瀬川武彦,川口靖夫,菊島義弘,松沼孝幸,吉田博夫

能動乱流制御による抵抗低減技術を確立するための基礎実験として、積層型ピエゾアクチュエー タアレー(図1)を閉ループ型矩形チャネルの壁面(図2)に装着し、能動制御による流れの変化を PIVで計測した。本実験においては、 $Re(=HU_m/v) = 7500$ における壁面近傍に存在する低速ストリーク 構造を制御対象とし、6個のアクチュエータをスパン方向に4mm間隔(~50  $v/u_{\tau}$ )で配置した。それ ぞれのアクチュエータは独立に、変位:100 $\mu$ m、振動数: f = 1kHz まで振動させることができる。

図 3(a)はアクチュエータを作動させていない状態で、y = 5mm ( $y^+ \sim 50$ ) での x-z 断面上の速度分布 を示しており、100  $v/u_t$ 程度のストリーク構造が存在していることがわかる。図 3(b)は、6 個のアクチュエータに 60 度ずつ位相差をつけて、f = 125Hz で振動させた場合の速度分布を示している。図 3(a) で見られたような低速構造が消滅している様子がわかる。本実験での条件下では、ストリーク構造が 消滅する臨界的な周波数は、f = 12.5Hz であることがわかった。



図1.アクチュエータアレー

図 2. 閉ループ型矩形チャネルと PIV



図 3.y<sup>+</sup>~50 における *x-y* 断面の速度分布.(a) 制御なし.(b) *f* = 125Hz. は流れの 方向、カラーテーブルは渦度を示している.アクチュエータアレーは *x* = -15mm に配 置されている.